

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成17年1月13日(2005.1.13)

【公表番号】特表2000-511300(P2000-511300A)

【公表日】平成12年8月29日(2000.8.29)

【出願番号】特願平9-542465

【国際特許分類第7版】

G 0 3 F 1/08

H 0 1 L 21/027

【F I】

G 0 3 F 1/08 A

H 0 1 L 21/30 5 0 2 P

【手続補正書】

【提出日】平成16年5月10日(2004.5.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

# 手続補正書

平成16年5月10日

特許庁長官 今井 康夫 殿

1. 事件の表示

平成9年特許願第542465号

2. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名称 イー・アイ・デュポン・ドウ・ヌムール・アンド・  
カンパニー

3. 代理人

〒107-0052

住所 東京都港区赤坂1丁目9番15号

日本自転車会館

氏名(6078)弁理士 小田島 平吉

電話 3585-2256

方 式 査 審



4. 補正命令の日付 なし

5. 補正の対象

請求の範囲

6. 補正の内容

1) 請求の範囲を別紙の如く訂正する。

以上



(別紙)

## 「 請 求 の 範 囲

1. アルミニウム化合物の少なくとも1層及び選択されたリソグラフィー波長 $< 400\text{ nm}$ においてアルミニウム化合物より光学的に吸収性である少なくとも1つの成分を含んでなる、 $180^\circ$ の移相を作り出し得且つ選択されたリソグラフィー波長 $< 400\text{ nm}$ において少なくとも0.001の光学的透過率を有する減衰する埋め込まれた移相フォトマスク・ブランク。

2. フォトマスク・ブランクがサーメット・フォトマスク・ブランクである、請求の範囲1のフォトマスク・ブランク。

3. フォトマスク・ブランクが多層フォトマスク・ブランクである、請求の範囲1のフォトマスク・ブランク。

4. アルミニウム化合物及びより光学的に吸収性の成分の交互の層を含んでなる、請求の範囲3のフォトマスク・ブランク。

5. フォトマスク・ブランクが複合物フォトマスク・ブランクである、請求の範囲1のフォトマスク・ブランク。

6. アルミニウム化合物が窒化アルミニウム、オキシ窒化アルミニウム及び酸化アルミニウムからなる群から選択される、請求の範囲1のフォトマスク・ブランク。

7. より光学的に吸収性の成分が元素状金属、金属酸化物、金属窒化物及びこれらの混合物からなる群から選択される、請求の範囲1のフォトマスク・ブランク。

8. より光学的に吸収性の成分が、(a) 元素状金属、(b) Ti、

Fe、In、Co、Bi、Mn、Cu、Sn、Cr、Ni、V、Nb、Ta、Mo、ランタニド系の金属又はWの酸化物、(c) Ti、Nb、Mo、Cr、W、Ta、Zr、HfまたはVの窒化物、及び(d)これらの混合物、からなる群から選択される、請求の範囲1のフォトマスク・ブランク。

9. 選択されるリソグラフィー波長が193、248及び365nmからなる群から選択される、請求の範囲1のフォトマスク・ブランク。

10. アルミニウム化合物の少なくとも1層及び選択されたリソグラフィー波長<400nmにおいてアルミニウム化合物より光学的に吸収性である少なくとも1つの成分を基板上に付着させることを含んでなる、180°の移相を作り出し得且つ選択されたリソグラフィー波長<400nmにおいて少なくとも0.001の光学的透過率を有する減衰する埋め込まれた移相フォトマスク・ブランクの製造法。

11. 付着工程が物理的蒸着を含んでなる、請求の範囲10の方法。

12. 物理的蒸着工程がスパッタリング及び蒸発からなる群から選択される、請求の範囲11の方法。

13. アルミニウム化合物が窒化アルミニウム、オキシ窒化アルミニウム及び酸化アルミニウムからなる群から選択される、請求の範囲10の方法。

14. より光学的に吸収性の成分が元素状金属、金属酸化物、金属窒化物及びこれらの混合物からなる群から選択される、請求の範囲10の方法。

15. より光学的に吸収性の成分が、(a)元素状金属、(b)Ti、

Fe、In、Co、Bi、Mn、Cu、Sn、Cr、Ni、V、Nb、Ta、Mo、ランタニド系の金属又はWの酸化物、(c) Ti、Nb、Mo、Cr、W、Ta、Zr、HfまたはVの窒化物、及び(d)これらの混合物、からなる群から選択される、請求の範囲10の方法。

16. より光学的に吸収性の成分が元素状金属であり、そして付着された層がアルミニウム化合物内に分散された元素状金属を含んでなる、サーメット・フォトマスク・ブランクを製造する、請求の範囲10の方法。

17. アルミニウム化合物及びより光学的に吸収性の成分の交互の層を付着させて、多層フォトマスク・ブランクを製造する、請求の範囲10の方法。

18. より光学的に吸収性の成分が元素状金属ではなく、そして付着された層がアルミニウム化合物及びより光学的に吸収性の成分の混合物を含んでなる、複合物フォトマスク・ブランクを製造する、請求の範囲10の方法。

19. 選択されるリソグラフィー波長が193、248及び365 nmからなる群から選択される、請求の範囲10の方法。 」

以上